

# マイクロ波 プラズマCVD装置

ダイヤモンド合成の研究・開発に最適な1台。

マイクロ波プラズマを用いた表面処理の研究・開発。

本装置は、マイクロ波プラズマを用いた表面処理や  
ダイヤモンド膜合成などに用います。

## 用途

- ダイヤモンド成膜
- 窒化炭素成膜
- カーボンナノチューブ
- 各種の気相プラズマ反応
- エッチング
- 表面処理



## DCV-MW2400 標準仕様

反応室	ジャケット:水冷式円筒型真空槽 材質:SUS304 サイズ:φ108×H196 マイクロ波導入窓:φ160(石英ガラス製) 覗き窓:φ14×1個(石英ガラス製) 基板ホルダー:水冷銅製シャフト構造 試料台:φ1インチ(モリブデン製) 基板交換:反応室底部昇降式
ガス導入系	マスフローコントローラ2系列
真空計	ピエゾ型隔膜真空計(フルスケール圧力:F.S.133 kPa) ピラニ真空計(圧力測定範囲: $5.0 \times 10^{-2}$ Pa $\sim$ $1.0 \times 10^5$ Pa)
排気系	油回転真空ポンプ:GHP-240B(240 L/min)オイルミストラップ付 排気速度調整:自動(圧力制御コントローラ付)
マイクロ波電源	周波数:2.45 GHz 容量:1.5 kW 整合器:手動E-Hチューナ モード変換器:TE10 $\rightarrow$ TM01に変換
ユーティリティ	設置スペース:W1300×D1250×H1750 電源容量:3φ 200V 8 kVA 冷却水:0.13 $\sim$ 0.15 MPaG 15 L/min以上 圧縮空気:0.4 $\sim$ 0.6 MPaG 所要ガス:CH <sub>4</sub> 、H <sub>2</sub>

## DCV-MW2400 オプション(有償)

- ・マスフローコントローラ(O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、Arなど)
- ・マイクロ波電源容量:3kW、5kW
- ・整合器:4Eチューナ型自動整合器
- ・放射温度計:600 $\sim$ 3,000°C(ファイバー式)
- ・プラズマモニター
- ・冷却水用チラー
- ・ボンベ台
- ・コンプレッサー

※外観・仕様については改善のため予告なく変更する場合があります。

## 大亜真空株式会社

### DIAVAC LIMITED

本社営業部/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495  
TEL. 047-459-7628 (ダイヤルイン) FAX. 047-459-3654  
大阪営業所/〒532-0002 大阪市淀川区東三国2-34-1/ハイランドビル4F  
TEL. 06-6396-1771 (代表) FAX. 06-6396-1774  
本社・工場/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495  
TEL. 047-459-5311 (代表) FAX. 047-459-3628

<https://www.diavac.co.jp/>

このカタログは古紙を使用しております。

#### 特約店